

多晶SiC制品

产品描述

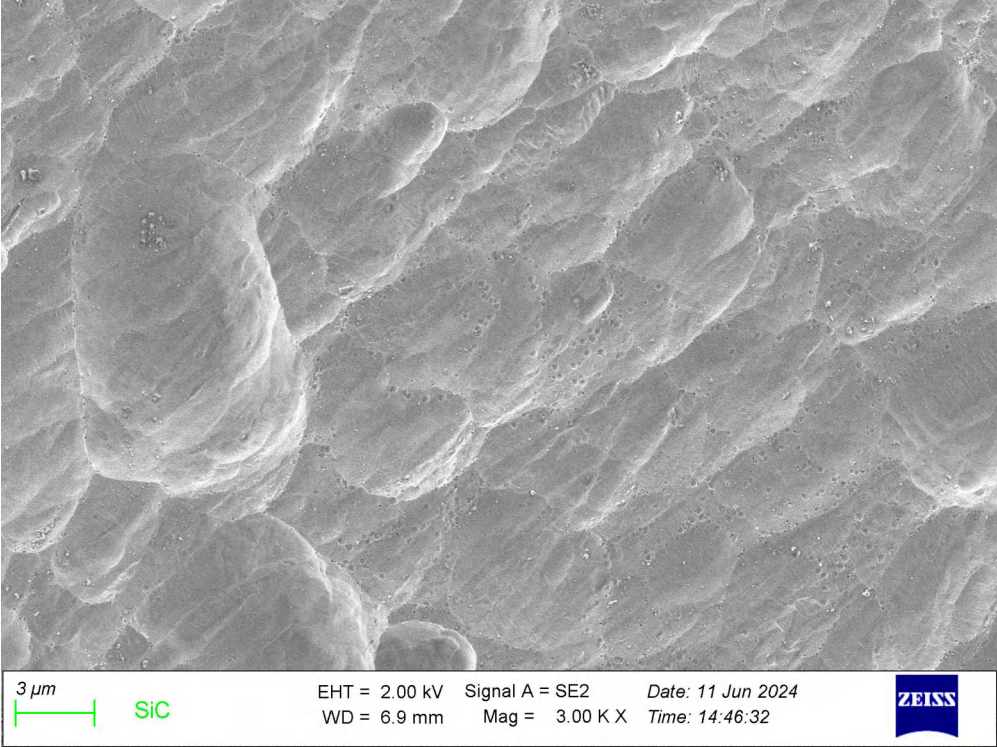
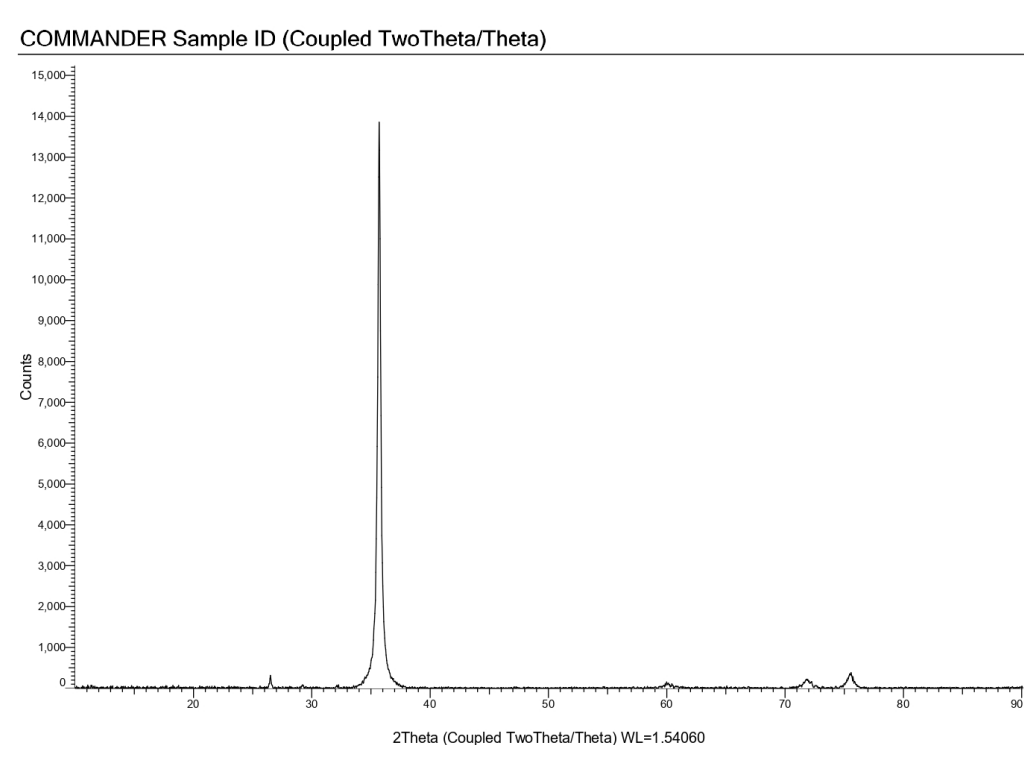
碳化硅聚焦环是用于半导体刻蚀工艺的关键部件，其作用是聚焦等离子体，提高刻蚀速率和均匀性，并保护腔体及刻蚀设备。我们的碳化硅聚焦环采用高纯度碳化硅材料，具有优异的耐等离子体腐蚀性能和高温稳定性。

主要特点

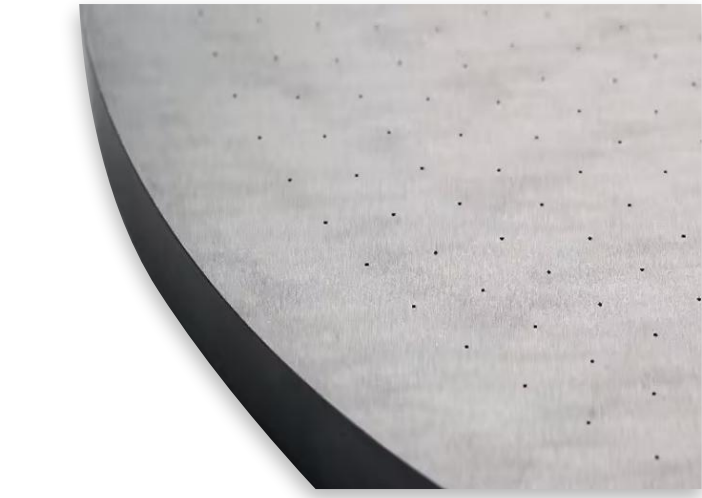
- 采用先进的 CVD 沉积技术和表面处理技术，有效延长产品使用寿命
- 结晶性良好，内部晶型以（111）为主导
- 体积电阻率灵活可调

应用领域

- 半导体制程：刻蚀



聚焦环及喷淋头



多晶衬底及定制结构件

